

# Verwendete Abkürzungen

AAS	Atom-Absorptions-Spektroskopie
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol
ACC	Autophoretic Coating Chemicals
AES	Atomic Emission Spectroscopy
AFM	Atomic Force Microscopy
ATL	Anodische Tauchlackierung
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CKW	Chlorkohlenwasserstoff
CVD	Chemical Vapour Deposition
DVD	Digital Versatile Disc
ECD	Electrochemical Deposition
EDTA	Ethylen Diamin Tetra Aceticacid
EDX	Energiedisperse X-Ray-Analyse
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EP	Epoxid
EPS	Elektrostatishes Pulversprühverfahren
ESMA	Elektronen-Strahl-Mikroanalyse
EUVL	Extrem Ultraviolet Lithografie
FCKW	Fluorchlorkohlenwasserstoffe
GS	Gleichstrom-Schwefelsäure-Verfahren
GSX	Gleichstrom-Schwefelsäure-Oxalsäure-Verfahren
HAL	Hot Air Levelling
HID	High Intensity Discharge
HKW	Halogenkohlenwasserstoff
IBE	Ion Beam Etching
IPC	Institute for Printed Circuits
IR	Infrarot
KTL	Katodische Tauchlackierung
KW	Kohlenwasserstoff
LIBS	Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

LIGA	Lithographie, Galvanik und Abformung
PE	Plasma Etching
PER	Tetrachlorethen
PFOS	Perfluoroctansulfonsäure
PUR	Polyurethan
PVD	Physical Vapour Deposition
R <sub>a</sub>	Mittenrauwert
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REM	Rasterelektronenmikroskopie
RFA	Röntgenfluoreszenzanalyse
FIBE	Reactive Ion Beam Etching
RIE	Reactive Ion Etching
RIP	Raster Image Prozessor
RoHS	Restriction of Hazardous Substances
RT	Raumtemperatur
R <sub>t</sub>	Rautiefe
R <sub>z</sub>	Gemittelte Rautiefe
SE	Sputter Etching
SEM	Sekundärelektronen-Mikroskopie
SIMS	Sekundärionen-Massenspektroskopie
TEM	Transmissionselektronenmikroskopie
UP	Ungesättigte Polyester
UV	Ultraviolett
WDX	Wave Length Disperse X-Ray-Analyse